

高真空蒸着装置 RD-1300R



高真空蒸着装置RD-1300Rは小型蒸着装置の水
晶振動式膜厚計搭載型抵抗加熱蒸着装置です。
研究機構向けに開発された本装置は、抵抗加熱
機構2対を装備しておりますので同時成膜が可能
です。また回転機構や基板加熱機構も装備して
おりますので、良質な成膜が可能です。排気系は、
ターボ分子ポンプを採用しており、クリーンな排気
が可能です。

高真空蒸着装置RD-1300R仕様

- 到達圧力 1.0×10⁻³Pa以下※ワーク挿入時・常温時
- 排気速度 6.7×10⁻³Pa迄本引開始後30分以内※ワーク挿入時・常温時
- 真空漏洩量 1.0×10⁻¹⁰Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ300mm×400mmH 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式2対(ポート)
AC10V0~50A
制御方式:サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム
2基同時成膜可能
- 基板形状 □100mm 1枚
- 基板回転 φ180回転基板台
基板回転数:0~10rpm
モーターコントローラ
- 基板加熱 インコネル製ヒーター(ヒーター板:石英)
常温~450℃迄昇温可能
ヒーター制御:サイリスタ制御
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:333L/min[50Hz]
ターボ分子ポンプ:550L/sec(N₂)
- 真空計 ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 手動
- 制御系 ターボ分子ポンプパワーサプライ/デジタル温調計(ポート部测温)
- ユーティリティ電気:AC200V三相4KVA
冷却水:0.2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
寸法:850mmW×800mmD×1860mmH
- オプション 単元電子銃(-4KV 750mA)